دراسة الخواص التركيبية و البصرية لنماذج اوكسيد الزنك المؤكسد بطريقة الأكسدة

الحرارية الحرة السريعة

عبد المجيد عيادة¹ ، رائد عبد الوهاب اسماعيل² ، ولاء محفوظ محمد¹ ¹قسم الفيزياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق ²قسم العلوم التطبيقية ، الجامعة التكنولوجية ، بغداد ، العراق

الملخص

تم في هذه الدراسة أكسدة أغشية الزنك المرسبة على أرضيات من الزجاج بدرجة حرارة (C ° 510) وبأزمان أكسدة sec (10,20,30). حيث تم ترسيب الزنك بطريقة الانتشار الحراري تم استعمال مسخن حراري بدلا من الأفران التقليدية. بينت النتائج إمكانية الحصول على اوكسيد الزنك بدون استعمال غاز الأوكسجين وبدون استعمال أفران مغلقة وبسرعة عالية نسبياً وهذه الطريقة تكون فعالة في عمليات الإنتاج بصفة صناعية ولكميات كبيرة. بين التحليل الطيفي ونتائج تحليل العناصر EDX تحول الزنك الى اوكسيد الزنك وبنسبة 90% وبفترة زمنية لا نتجاوز 300% وبينت نتائج تحليل الأشعة السينية الحصول على نظام بلوري وبالمستويات البلورية (002) و (101). أما نتائج دراسة مجهر القوى الذرية البعد النانوي هو 61.37nm في معال المستويات البلورية على هذا التحول حيث بينت ان مقدار فجوة الطاقة للانتقالات المسموحة المباشرة البعد النانوي هو 3.37nm في المائن المستويات البلورية على هذا التحول حيث بينت ان مقدار فجوة الطاقة للانتقالات المسموحة المباشرة

المقدمة

يعد الوكسيد الزنك واحد من أهم المواد الشبه موصلة استعمالا في تصنيع الكواشف والخلايا الشمسية^[11]. كما ويدخل في تكنولوجيا متحسسات الغازات وشاشات العرض السائلة . يمتلك اوكسيد الزنك تركيب بلوري سداسي (Hexagonal) و فجوة طاقة 3.3eV وهو ينتمي الى المجاميع (II-VI) من الجدول الدوري من النوع السالب^[2] يهدف البحث الحالي الى الحصول على أغشية اوكسيد الزنك بطريقة تتصف بالسرعة وبتكلفة قليلة وإمكانية استعمالها بطريقة صناعية وان تتصف الأغشية الناتجة بتحول الزنك فيها الى الوكسيد الزنك بشكل كامل وبترتيب بلوري منتظم.

الجانب العملي

تم تحضير أغشية الزنك باستعمال التبخير الحراري بالفراغ حيث تم استعمال منظومة تفريغ عالي^[3]. تعمل على تفريغ الحجرة من الهواء وعند وصول الضغط الى 1.9rX10⁻⁴mbar تم تبخير مسحوق الزنك والذي تصل نقاوته الى 99% . باستعمال بودقة من مادة التنكستن. تمت عملية الترسيب على قواعد من الزجاج ذات الأبعاد 2X2.5cm بعد غسلها بواسطة الماء المقطر الأيوني ثم محلول الميثانول وبعدها محلول الايثانول ثم شطفها بالماء المقطر وتجفيفها. تم احتساب سمك الغشاء باستعمال الطريقة الوزنية وفيها يتم وزن قاعدة الزجاج قبل وبعد الترسيب وباستعمال المعادلة التالية(1) أمكننا إيجاد سمك الغشاء t .

$$t = \frac{m_2 - m_1}{A \cdot \rho_{Zno}} \tag{1}$$

حيث إن (m₂-m₁) هو الفرق في الوزن قبل وبعد الترسيب أما ρ فتمثل كثافة المادة .

في هذه البحث تم استعمال مسخن مسطح تم ضبط درجة حرارته عند 510°C بدون وضعة في حيز مغلق وبدون استعمال قنينة أوكسجين عند ارتفاع درجة حرارة المسخن الى الدرجة المطلوبة تم وضع نماذج

أغشية الزنك مباشرة إي إن المادة ترتفع درجة حرارتها بشكل سريع وغير تدريجي وعملية التبريد تمت أيضا بسرعة. تم تحضير نماذج مؤكسدة لمدة sec (30, 20, 30).

أجريت على هذه النماذج دراسة للخواص البصرية لإيجاد فجوة الطاقة البصرية وفجوة الطاقة للانتقالات المباشرة المسموحة والممنوعة .كما تم أجراء فحص باستعمال المجهر الالكتروني EDX لتحليل العناصر لإيجاد نسبة تحول الزنك الى اوكسيد الزنك. أما نتائج تحليل الأشعة السينية X-Ray فتم بواسطتها التعرف على التركيب البلوري للنماذج. تم استعمال معادلة براك لحيود الأشعة السينية في احتساب المسافة بين الذرات d والتى تعطى بالعلاقة ^[3]

 $2dsin\theta = n\lambda$ (2)

^[6] أما ثوابت الشبيكة الأساسية $a_0 \in c_0$ تم احتسابها من العلاقة التالية $\frac{1}{2} = \frac{4}{2} \left(\frac{h^2 + hk + k^2}{2}\right) + \frac{l^2}{2}$ (3)

$$\frac{1}{d^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{a_0^2} \right) + \frac{1}{c_0^2}$$
(3)

ومعدل الحجم الحبيبي D_{av} تم احتسابه باستعمال علاقة (ديباي- شير) [6].

$$D_{av} = \frac{0.9\lambda}{B\cos\theta} \qquad (4)$$

حيث إن B تساوي قيمة FWHM وθ هي زاوية الحيود اما λ فتمثل. الطول الموجى للاشعة السينية .

القياسات التركيبية و البصرية

تم دراسة طيفي الامتصاصية والنفاذية باستعمال جهاز من نوع SHIMADZU من نوع الحزمتين تم برمجته ليكون مدى الاطياف ألموجي nm(900-300) وبدقة 0.1nm أما القياسات التركيبية فتمت باستعمال جهاز X-Ray ويمر تيار 30mA لهدف من النحاس ويولد طول موجي (1.5406A°) أما الدراسات السطحية فتمت باستعمال جهاز AFM من نوع SPM .

مجلة تكريت للعلوم الصرفة، 22(1) 2017

ISSN: 1813 – 1662 (Print) E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)

النتائج والمناقشة

أولا دراسة الخصائص التركيبية لنماذج ZnO

1- دراسة الخواص التركيبية باستعمال حيود الاشعة السينية

تمت دراسة الخواص التركيبية و باستعمال جهاز X-Ray يبين الشكل

(1) غشاء Zn المؤكسد لمدة 10secوالموضحة بالجدول(1) . يمكن

ملاحظة أن الخواص التركيبية لمركب ZnO هي الأساسية والغالبة على Zn. وان الاتجااه (002) عند الزاوية 34.4 تكون هي المهيمنة لمركب ZnO بحجم حبيبي 28,56nm يليه عند الزاوية 36.3 بالاتجاه (101) بحجم حبيبي 38.399nm. أن الاتجاه عند الزاوية 38.8 (101) هي الوحيدة بالنسبة للزنك بحجم حبيبي 37.7nm.



شكل (1) يبين حيود الأشعة السينية لغشاء Zn مؤكسدة لمدة 10sec

Grain size (nm)	d(A ^o)	hkl	20	
33.79	2.80877	100	31.8344	
28.56	2.60199	002	34.4401	ZnO
38.39	2.47239	101	36.3067	
37.70	2.06390	101	43.8294	Zn

يبين الشكل (2) والجدول(2) نتائج حيود الأشعة السينية لغشاء Zn

جدول (1) نتائج حيود الأشعة السينية لغشاء Zn مؤكسدة لمدة 10 sec

عنصر الزنك الى اوكسيد الزنك. كما تبين ازدياد في شدة الزوايا الخاصة بمركب ZnO بالإضافة الى تكون بناء بلوري بزوايا جديدة تابعة للمركب ZnO مما يدل على تحول عنصر Zn الى مركب ZnO بنسبة عالية. الحجم الحبيبي لمركب ZnO عند زاوية 31.7 بمعاملات ميلر (100) مساوي 65.7nm أما عند الزاوية 36.1 بمعاملات ميلر (101) كان الحجم الحبيبي 54.6nm وعند أعلى شدة بالزاوية 34.35 بمعاملات ميلر (002) كان الحجم الحبيبي 62.4nm.

عند الأكسدة لمدة 20sec بينت النتائج بان الشدة في مقدار الأشعة بالزا السينية المنعكسة عند الزاوية 43.8 قد انخفضت مما يدل على تغير nm



شكل (2) نتائج حيود الأشعة السينية لغشاء Zn عند الأكسدة لمدة 20 sec

أما الشكل (3) والجدول(3) فيبين نتائج حيود الأشعة لغشاء Zn مؤكسد لمدة 30sec . يمكن ملاحظة بان الصفة البلورية لمركب ZnO هي السائدة للغشاء . وان العشوائية في حيود الأشعة السينية تكون قليلة جداً .إن أعلى شدة عند الزاوية 36.3 بمعاملات ميلر (101) عند الحجم الحبيبي 59.6nm يليها الشدة عند الزاوية 34.4 بمعاملات ميلر (002) بالحجم الحبيبي 45.70nm. أما عنصر Zn عند الزاوية 43.2 فقد انخفضت شدته بشكل كبير دلالة على أكسدته الى ZNO .

جدول (2) نتائج حيود الأشعة السينية لغشاء Zn مؤكسدة لمدة 20 sec

Grain size (nm)	d(A ⁰)	hkl	20	
65,72	2.81986	100	31.7059	
62,47	2.60790	002	34.3596	
54,64	2.48169	101	36.1658	7.0
69,88	1.91523	102	47.4311	ZIIO
82.11	1.62705	110	56.5147	
57,68	1.48052	103	62.7034	
45,24	2.06422	101	43.8222	Zn



شكل (3) يبين نتائج حيود الأشعة لغشاء Zn مؤكسد لمدة 30sec

Zn مؤكسدة لمدة30sec	لأشعة السينية لغشاء	بدول (3) نتائج حيود ا	÷
---------------------	---------------------	-----------------------	---

Grain size (nm)	d(A ^o)	hkl	20	
58,45	2.81422	100	31.7712	
45.70	2.60220	002	34.4373	ZnO
59.67	2.47254	101	36.3044	
78.00	2.09066	101	43.2398	Zn

 دراسة الخصائص التركيبية النانوية لأغشية Zn المؤكسدة باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM)

تم تصوير أغشية الزنك والمؤكسدة لمدة 30,20,10) بواسطة مجهر القوة الذرية (AFM) بعد تقطيع النماذج الى أبعاد (1X2)cm). بينت الصور وجود تعرجات ومناطق ذات ارتفاع وانخفاض في جميع النتائج . عند الأكسدة لمدة 10sec بلغت هذه التعرجات بارتفاع 78.08m كما في الشكل a(4) وانخفضت الى

2.16nm عند الأكسدة لمدة 20sec كما في الشكل a(5) بعدها ارتفعت الى 38.03 كما فى الشكل a(6).

تدل هذه النتائج الى أن معدن الزنك المرسب على أرضيات من الزجاج يمتلك سطح خشن أما أثناء عملية تحوله الى اوكسيد الزنك فان سطحه يكون أملس تقريباً ويعود لكونه سطحه بنصف خشونة الزنك تقريباً عندما يتحول الى اوكسيد الزنك . تعد هذه الخاصية مهمة خاصة عند بناء كاشف من اوكسيد الزنك فكلما كان السطح اخشن كلما كان عامل الامتصاصية اكبر وازدادت كفاءة الكاشف

بينت النتائج من خلال استعمال المجهر التحققي ان معدل البعد النانوي عند الأكسدة لمدة 10sec كانت 74.40nm كما في الشكل (4) وارتفعت قليلاً الى 78.05nm كما في الشكل (5) أما عند تحول العينة الى اوكسيد الزنك انخفض معدل البعد النانوي الى 61.37nm كما في الشكل (6) مما يدل على تحسن في تركيب الغشاء



شكل(a(4)– صورة فوتوغرافية لسطح غشاء الزنك المؤكسد 10sec باستعمال مجهر القوة الذرية (AFM)–b– الرسم البياني لغشاء الزنك المؤكسد لمدة 10sec باستعمال المجهر التحققي



شكل(a(5) صورة فوتوغرافية لسطح غشاء الزنك المؤكسد 20sec باستعمال مجهر القوة الذرية (AFM) -b- الرسم البياني لغشاء الزنك المؤكسد لمدة 20sec باستعمال المجهر التحققي



شكل(a)a– صورة فوتوغرافية لسطح غشاء الزنك المؤكسد 30sec باستعمال مجهر القوة الذرية (AFM) –b– الرسم البياني لغشاء الزنك المؤكسد لمدة 30sec باستعمال المجهر ألتحققي

3. دراسة الخصائص التركيبية السطحية وتحليل العناصر لأغشية Zn المؤكسدة باستخدام تحليل العناصر EDX . تمت دراسة الخواص السطحية لغشاء الزنك عند اكسدته

10,20,30)sec) . الشكل (7) يبين تحليل للعناصر بواسطة

(EDX) لغشاء Zn مؤكسد لمدة 10sec يمكن ملاحظة أن كمية الأوكسجين مساوية الى %26.22 اما كمية الزنك فهي مساوية الى %70.38 ونسبه قليلة جدا من السيلكون %3.41 . تشير النتائج الى ان نسبة أكسدة Zn وتحوله الى ZnO قليلة ولا تتجاوز %20 .



الشكل (7) يبين تحليل للعناصر (XRD) لغشاء Zn مؤكسد لمدة 10sec

اما الشكل (8) فيبين نتيجة التحليل للعناصر لغشاء Zn مؤكسد لمدة 20 ويظهر فيه ارتفاع في نسبة الاوكسجين بالمركب الى 63.72 % مع انخفاض في قيمة zn الى % 36.26 . الشكل (9) يبين نتيجة التحليل للعناصر لغشاء Zn المؤكسد لمدة 305c وفيه فان كمية

الاوكسجين %49.81 وكمية الزنك 50.19 . نلاحظ ان كمية الاوكسجين مساوية الى كمية الزنك مما يدل على تحول الغشاء Zn الى غشاء



شكل (8) يبين تحليل للعناصر (XRD) لغشاء Zn مؤكسد لمدة 20sec

								Spect	rum 1
01			27	A					
0	2	6	8	10	12	14	16	18	

الشكل (9) يبين تحليل للعناصر (XRD) لغشاء Zn مؤكسد لمدة 30sec

دراسة الخواص البصرية لنماذج ZnO

يقوم المطياف الخاص بجهاز محلل الطيف (UV spectrum) بإسقاط فوتونات عند طول موجي معين وبالتالي فان عملية امتصاص المادة لهذا الطول ألموجي تعتمد على أمكانية تهيج بذراتها أو الكتروناتها وتغاعلها مع هذه الطاقة كانتقالها من حزمه التكافؤ إلى حزمة التوصيل . يبين الشكل ه(10) النفوذية لمدى الطيف الواقع بين وجود قمة تقع عند الطول ألموجي 10sec وفيه يمكن ملاحظة وجود قمة تقع عند الطول ألموجي 300(340) كما أن علاقة النفوذية الأطوال الموجية لاوكسيد الزنك حيث تبدأ بالارتغاع عند الأطوال الموجية الاوكانية الفوتون الساقط . ولإيجاد فجوة الطاقة للانتقالات المباشرة المسموحة تم الاستعانة بالشكل عا(10) ولذي يمثل العلاقة ما بين ²(αhv) وبين طاقة الفوتون الساقط أما

فجوة الطاقة للانتقالات المباشرة الغير مسموحة تم الاستعانة بالشكل (10) والذي يمثل العلاقة ما بين ^{2/3} (αhv) وبين طاقة الفوتون الساقط. الشكل يبين وجود عدة دالات للامتصاص ويغجوة طاقة مسموحة 3.5eV وفجوة طاقة محظورة 3.8eV مما يدل على إن الأكسدة لمدة 10sec غير كافية لتحويل الزنك إلى اوكسيد الزنك بشكل كامل.

الشكل (11) يبين الخواص البصرية لنموذج مؤكسدة لمدة 20sec وعند المقارنة مع الشكل السابق يمكن ملاحظة انخفاض في قيمة القمة الشاذة في الامتصاصية إما فجوة الطاقة المباشرة المسموحة والتي تم احتسابها من الشكل ط(11) أصبحت (3.9eV) وفجوة الطاقة المباشرة الممنوعة (3.6eV) النتائج السابقة هي اكبر من النتائج المعتمدة لاوكسيد الزنك وتدل على كون الأكسدة لمدة 20sec هي غير كافية لتحويل أغشية الزنك إلى اوكسيد الزنك.



شكل (10) النتائج البصرية لنموذج مؤكسد لمدة a-. 10 sec- منحني النفوذية كدالة للطول ألموجي-b- معامل الامتصاص -c- فجوة الطاقة المباشرة المسموحة -b- فجوة الطاقة المباشرة المحظورة

الشكل (12) يوضح الخواص البصرية لنموذج مؤكسد لمدة 30sec يبين الشكلa(12) النفوذية لهذا النموذج وهو مطابق إلى امتصاصية أغشية اوكسيد الزنك المعتمدة للباحث ^[7]. ومن الشكل ط(12) تم احتساب فجوة الطاقة البصرية وهي تساوي 3.2eV اما فجوة الطاقة للانتقالات المباشرة المسموحة فكانت 3.22eV والتي تم احتسابها من الشكل ع(12) برسم خط مستقيم على امتداد منحني الامتصاص

وبنفس الطريقة تم احتساب مقدار فجوة الطاقة للانتقالات المباشرة الممنوعة من الشكل (21) وكانت تساوي 3.18eV. أن النتائج المعطاة من النموذج المؤكسد لمدة 30sec اتفقت بشكل كبير مع القيم المعطاة لاوكسيد الزنك للباحثين ^{[8][9]} وبالتالي يمكن الاستنتاج بان اقل زمن أكسدة حرة لتحول أغشية الزنك إلى اوكسيد الزنك هو sec 30.



شكل (11) النتائج البصرية لنموذج مؤكسد لمدة a-. 20 sec- منحني النفوذية كدالة للطول ألموجي-b- معامل الامتصاص -c- فجوة الطاقة المباشرة المسموحة-d- فجوة الطاقة المباشرة المحظورة



شكل (12) النتائج البصرية لنموذج مؤكسد لمدة a-. 30 sec- منحني النفوذية كدالة للطول ألموجي-b- معامل الامتصاص -c- فجوة الطاقة المباشرة المسموحة-d- فجوة الطاقة المباشرة المحظورة

الاستنتاجات

تم تحليل النتائج باستعمال قياسات كارتات JCPDS ^[5] والنظريات العلمية , بالإضافة الى المعلومات الواردة في الكتب والمجلات العلمية ومن الدراسات السابقة والبحوث التي أجريت على الكواشف القريبة من فحوى هذه الدراسة وتم التوصل الى الاستنتاجات الاتية :

1- أمكانية تحويل الزنك الى اوكسيد الزنك باستعمال مسخنات حرة بدون أفران وبطريقة رفع درجة حرارة الغشاء الى 510°C وخفضها بسرعة بفجوة طاقة بلغت 3.18eV.

المصادر

6- Zhaia Jing, Taoa Xia, Pua Yuan, Zenga Xiao-Fei, Chenb Jian - Feng" Core-shell structured ZnO/SiO2 nanoparticles: Preparation characterization and photocatalytic property" Applied Surface Science, 257, 393–397 (2010)

7- H. L. Tsaia, W.C. Lia, M. J. Chena, M. Shiojirib, J.R. Yang a, The structure and ultraviolet electroluminescence of n-ZnO–SiO2–ZnO nanocomposite/ p -GaN heterojunction LED. ECS Transactions, 33 (2) 267-275 (2010)

8- A.G. Milnes & D.L. Feucht, "Heterojunctions and Matal-Semiconductor junction", Academic Press, London, (1972).

9- J. SUSKI, D. LARGEAU and A. STEYER. Optically Activated ZnO/SiO2, /Si Cantilever Beams, 'Sensors and Actuators A, 24221-225(1990)

2- ان اقل زمن لازم لتحويل غشاء من الزنك الى اوكسيد الزنك هو
30sec

3- بينت نتائج X-Ray ان نماذج اوكسيد الزنك تملك نظام بلوري منتظم بمعاملات ميلر (002) و (101)

4- بينت نتائج تحليل العناصر EDX ان نسبة تحول الزنك الى
اوكسيد الزنك تتجاوز 99%

5- تعد هذه الطريقة في أكسدة الزنك زهيدة الثمن ولا تحتاج الى تقنيات او غاز الاوكسجين .

 Al-Sabayleh, M.A., J. Sci. Med., 20(1) 17(2008).
Kislov N., Lahiri J., Verma H., Stefanakos D., Batzill M., Photocatalytic degradation of methyl orange over single crystalline ZnO: orientation dependence of photoactivity and photostability of ZnO, Langmuir, 25, 3310–3315 (2009)

3- S.M. Sze, "Semiconductor Devices Physics and Technology" Translated to Arabic by F.G. Hayaly, H.A. Ahmed, Baghdad, (1990).

4- Synthesis and Characterization of ZnO / SiO2 Core - Shell Microparticles and Photolytic Studies in Methylene Blue. Ali İmran Vaizoğullar, Ahmet Balcı International Journal of Research in Chemistry and Environment Vol. 4 Issue 2 April (161-165) 2014

5- Standard X-ray Diffraction Powder Patterns, 25/sec.18 UNIV.of ARIZONA .

Studying the Structural and Optical Properties of ZnO how Prepared by oxidation free quick hating

Abdul Majeed E. Ibrahim¹, Raid A.Isma'l², Wlla M. Mohammed¹

¹ physics Department, College of Education for pure science, Tikrit University, Tikrit, Iraq ² Applayed science Department, University of technology, Baghdad, Iraq

Abstract

In this study we oxidation thin film of Zinc on glass substrate in 510° C and oxidation time (10,20,30)sec . we intrusion the Zinc by using thermal diffusion. we exchange oven by appliance heater. the result show possibility relatively zinc oxide without using oxygen gas or closed oven and relatively so fast .this path is applied in production industrially and for large quantity. spectral analysis and elements analysis EDX explicit conversion zinc to zinc oxid purity 99% in oxidation time 30 sec . X-Ray analysis show that zinc oxid have Crystal system in crystal planes (002) and (101) .and AFM analysis show average nano dimension is 61.37nm .the study of optical properties clarifies the conversion. the result of energy gap for allow direct transmission 3.22eV and the energy gap for forbidden transmission 3.18eV .